

光応用・視覚研究会

〔委員長〕石井弘允(日大)

〔幹事〕白水俊次(長野高専), 小野 隆(日大)

日時 11月22日(金) 13:00~17:00

場所 東京電機大学7号館1階7101会議室(東京都千代田区神田錦町2-2, JR中央線, 神田駅より徒歩10分, Tel 03-5280-3407)

協賛 超微細リソグラフィ技術調査専門委員会(委員長 堀内敏行, 幹事 高橋信一, 塘 洋一, 幹事補佐 大木茂久)

議題 公開研究会テーマ「次世代リソグラフィ技術」

LAV-02-06 〔基調講演〕65nmSoCの実現に向けて -あすかプロジェクト-

若宮 互(半導体先端テクノロジーズ)

LAV-02-07 EUVAにおけるEUV光源開発計画

溝口 計(ギガフォトン), 遠藤 彰(コマツ), 小森 浩, 佐藤弘人, (ウシオ電機)

LAV-02-08 第二世代PXL技術の進展

北山豊樹(三菱電機)

LAV-02-09 EBマスク

田村 章(凸版印刷)

LAV-02-10 LEEPL露光装置の開発状況

野末 寛(リープル)

LAV-02-11 フッ素レーザーレジスト開発

内藤卓哉, 斎藤 聡, 信田直美, 後河内 透(東芝)